# 結晶成長

# KENZOU

### 2022.05.16

昔,たしか中学校での理科の時間だったと記憶しますが...『ミョウバンをたっぷりと溶かした温水溶液に ミョウバンの種結晶をぶら下げておきます。ビーカーのまわりを乾いた雑巾などでくるんでゆっくりと時間をか けて温度を下げていくと,このような綺麗な正八面体の透明な結晶ができます。』と先生が誇らしげに見せてく れました。オッ!そうなんやと感動し,家に帰って早速やってみましたが,1日経っても2日経ってもコップの 中はなんの変化もないただ透明な水溶液のまま。。。という苦い経験があり,結晶成長といえばすぐにこのことが 思い浮かびます。そのリベンジというわけではないですが,結晶成長はどのようにして起こるのかを以下に見て いこうと思います。

### §1.

結晶の育成法

- ・融液法: 例えば多結晶を融点以上に加熱して溶かし,そこから単結晶を育成していく方法で,過冷 却度が結晶化の駆動力となります。ここで過冷却度というのは  $\Delta T = T_m - T(T_m: 融点, T: 実$ 際の温度)で定義されます。
- ・溶液法:溶液法は固体を溶媒に十分に溶かして飽和濃度にしてから単結晶を育成していく方法で,結晶化の駆動力は溶液の徐冷や溶媒の蒸発による過飽和度が結晶化の駆動力になります。過飽和度は α = (C C<sub>eq</sub>)/C<sub>eq</sub>(C:実際の濃度,C<sub>eq</sub>:飽和濃度)で定義されます。 この両者の違いは,融液成長は結晶を取り囲む環境が結晶と同程度の密度をもった濃厚環境相であるのに対して,溶液法は各分子<sup>1</sup>が溶媒に取り囲まれているので希薄環境相からの成長とみなせる点にあり,その意味で溶液法の結晶成長プロセス(素過程)は次の気相成長法に極めて近いという特長をもちます。
- ・気相法:気相(蒸気相)からの結晶成長で,結晶を取り巻く環境が溶液法とよく似た希薄環境相という特長を持ち,過飽和度 $\sigma = (P P_{eq})/P_{eq}(P_{eq}: 平衡蒸気圧, P:実際の蒸気圧)が結晶成長の駆動力となります。$
- ・固相法:高圧加熱により結晶粒内の歪エネルギーや粒界のエネルギーを解放する方向に結晶粒の整理統合を促進させて単結晶を生成していく方法で,結晶成長の駆動力は歪エネルギーや粒界エネルギーで表されます。。

<sup>1</sup> 注:このレポートでは原子,分子,イオン等を特に区別することなく,誤解を招かない範囲で「分子」と総称しました。

2

2-1.結晶成長と熱力学

物質が一つの相と呼ばれる均質な状態から他の相に移り変わる現象は相転移と呼ばれますが,塩水から塩の結晶が析出する現象は液相から固相(結晶相)への相転移です。問題はそのような相転移がな ぜ起こるのか,それを熱力学的立場から究明していこうというわけです。ということで,しばらく熱力 学の復習をしておくことにします。

熱力学にはご承知のように第1,第2,第3法則があり,次のようなものでした。

(第1法則:熱エネルギーと力学的エネルギーの総量は保存される (エネルギー保存則)。

第2法則:外部から吸収した熱量 Qを全部力学的な仕事 W に変えることは不可能。

孤立系での非可逆変化はエントロピー *S* が増大する (エントロピー増大の法則)。 系は自由エネルギーが減少する方向に進行する。

第3法則:固体の純物質の絶対0度におけるエントロピーは0である。

A. 状態量

温度 T, 圧力 P, 体積 V, エントロピー S などのように 物質系の状態を表す物理量 を状態量と呼ん でいます。これらの状態量を独立変数として取り扱う場合は状態変数, 関数として取り扱う場合は状 態関数と呼ばれることもあります。いずれにしても「状態量」は系の現在の状態だけによって決まる量 で,過去の道筋には関係しません。系が変化する途中で吸収する熱量 Q や外部に対してする仕事 W は 変化の経路によって異なるので状態量ではありません。

状態量のうち,下記に示す内部エネルギーE,エンタルピーH,ギブスの自由エネルギーG,ヘルム ホルツの自由エネルギーFは,一般にP,V,T,Sの関数として表されることが多いので,これらは とくに熱力学関数とかエネルギー関数,また,熱力学ポテンシャルなどと呼ばれます。

- 内部エネルギー E: 原子・分子の並進運動や回転・振動のエネルギー,分子間力によるポテンシャルエネルギー等の総和。系全体としてもつ運動エネルギーや重力などの外からの力場に対するポテンシャルエネルギーは含まれない。
- エンタルピー H:内部エネルギー E と体積変化にもとづく仕事量 PV との和で H = E + PV で 定義されます。
- エントロピー $S: dS \ge dQ/T$  (等号は可逆変化の場合)で定義される状態量で,内部エネルギーのうち力学的仕事に変えることのできない部分の尺度にあたります。つまり,エントロピー増加に伴い内部エネルギーの内の仕事に利用できるエネルギーは少なくなるわけです。統計力学では $S = k_B T \ln \Omega$  で定義され, $\Omega$ は一つの巨視的な状態を構成するのに可能な微視的状態数<sup>2</sup>で,系の無秩序・乱雑さの程度を表す量となります。尚, $k_B: ボルツマン$ 定数 ( $1.38 \times 10^{-16} erg/deg$ ),T:絶対温度。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>微視的状態の数とは,例えば懐中電灯を持っている 10 人のグループ M があり,それを観測者 A が遠くから眺めていたとします。M の中の 1 人が懐中電灯を点灯したとすると A は一つの明かりを確認しますが,誰が点灯したかは 10 通りあります。メンバーが元気になって 2 人が点灯したとすると,遠方の A は 2 つの明かりを確認しますが,同様に誰が点灯したかはわかりません。10 人中の 2 人が点灯する場合の数は  $_{10}C_2 = \frac{10!}{2!*8!} = 45$ 通りあります。さらに元気になって,3 人が点灯する場合の数は  $_{10}C_3 = \frac{10!}{3!*7!} = 120$ 通りとなります。。。遠方にいる A が観測した明かりの数を内部エネルギーとみなすと,誰が点灯したかの数が微視的状態数にあたります。つまり,熱運動が活発化し内部エネルギーは上昇しますが,それ以上にエントロピー増大の方が圧倒的に大きいということですね。

• 自由エネルギー F,G:自由に仕事に変えることのできるエネルギー。

・ヘルムホルツの自由エネルギー: F = E - TS (2.1)

・ギブスの自由エネルギー : G = E + PV - TS = F + PV = H - TS

通常,条件設定がしやすい定温・定圧化での系の変化を扱うことから,ヘルムホルツよりギブスの自由エネルギーが採用されることが多いです。本レポートも特にことわらない限りGを採用しています。//

なお,参考までに エネルギー関数とその微分式,マクスウェルの関係式を以下に載せておきます。 尚,マクスウェルの関係式で左辺は測定できますが右辺は測定できません。つまり,この関係式によっ て、測定が困難なエントロピーの変化量を圧力、温度、体積の変化という測定がより簡単な量で置き換 えることができるというわけです。

内部エネルギー: 
$$E = Q - W$$
 ,  $dE = TdS - PdV$  ,  $\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_T$   
エンタルピー:  $H = E + PV$  ,  $dH = TdS + VdP$  ,  $\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = -\left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$   
H.自由エネル-:  $F = E - TS$  ,  $dF = -SdT - PdV$  ,  $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T$   
G.自由エネルギ-:  $G = H - TS$  ,  $dG = -SdT + VdP$  ,  $\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = -\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T$ 

$$(2.2)$$

すでに述べたように結晶化というのは熱力学的には液相から固相への相転移で,第2法則によれば 系は<u>自由エネルギーの極小化</u>を目指していることになります(熱力学ポテンシャルの極小化)。

ザックリ説明すると,Gの中で低温ではTSの項の寄与が小さい のでエンタルピー H が低い状態(結晶相)が安定状態となり,温 度が上昇するに伴い分子の熱運動が活発化により無秩序状態に向 かってエントロピーの項が大きく効いてくるので,乱雑度の高い 液相が安定状態となります。途中の結晶相と液相の自由エネルギー が等しくなる温度  $T_m$  では2相が安定に共存することになります。  $T_m$  を融点あるいは平衡温度と呼んでいます。

$$\left\{egin{array}{ll} G_{C} < G_{L} : 結晶相が安定 \ G_{C} = G_{L} : 結晶相と液相共存 \ G_{C} > G_{L} : 液相が安定 \end{array}
ight.$$



図 1: G vs T の模式的関係

B.示量変数・示強変数

「状態変数」には示量変数(extensive variable)と示強変数(intensive variable)の2種類あり,体 積などのように系の大きさに比例して変化する量を示量変数,圧力や温度,密度のように系の大きさ に無関係な量を示強変数といい,次のようなものがあります。

状態変数示量変数: 
$$V, S, H, E, F, G$$
示強変数:  $P, T, \mu, \rho$ 

なお,状態変数の内で,示強変数と示量変数の積がエネルギーの次元をもつものは互いに共役関係に あるといいます。

エントロピー S は示量変数?と疑問に思われるかも知れませんが,これは次のことから明らかです。 微視的状態数 W に微視的な状態 W'を付け加えた全体の状態数は  $W \times W'$ で,したがって系全体のエントロピーはこれら微視的状態のエントロピーの和  $S = k \ln(W \times W') = k \ln W + k \ln W' = S + S'$ で表されます。

エネルギー	示強変数	示量変数	
仕事:PV	P	V	-
熱量: $Q$	T	S	
化学エネルギー: $N\mu$	$\mu$	N	(N:物質量)

#### 表 1: 共役な示強・示量変数

C. 化学ポテンシャル

示強変数の中で化学ポテンシャル $\mu$ はこれから大活躍しますので詳しく説明しておきす。  $\mu$ は次式で定義され,<u>定温,定圧下での分子1個あたりの自由エネルギー</u> を表します。

$$\mu(P,T) = \left(\frac{\partial G}{\partial N}\right)_{P,T} \tag{2.3}$$

自由エネルギーGは示量変数なので分子数Nが $\lambda$ 倍になるとGも $\lambda$ 倍になるので

$$G(\lambda N, P, T) = \lambda G(N, P, T) \tag{2.4}$$

と表せます。P, Tは示強変数なので $G(\lambda P, \lambda T) = G(P, T)$ であることに留意すると, (2.4)は

$$G(\lambda N, \lambda P, \lambda T) = \lambda G(N, P, T)$$
(2.5)

と表わせますね。 $\lambda N \equiv x, \lambda P \equiv y, \lambda T \equiv z$ とおき (2.5) の左辺を  $\lambda$  で微分して

$$\frac{\partial G}{\partial \lambda} = \frac{\partial G}{\partial x}N + \frac{\partial G}{\partial y}P + \frac{\partial G}{\partial z}T$$
(2.6)

一方,右辺の $\lambda$  微分はG(N,P,T)で,これらは等しいので

$$\frac{\partial G}{\partial \lambda} = \frac{\partial G}{\partial x}N + \frac{\partial G}{\partial y}P + \frac{\partial G}{\partial z}T = G(N, P, T)$$
(2.7)

ここで  $\lambda \rightarrow 1$  とすると,  $x \rightarrow N, y \rightarrow P, z \rightarrow T$  となるので上式は<sup>3</sup>

$$G(N, P, T) = \frac{\partial G}{\partial N}N + \frac{\partial G}{\partial P}P + \frac{\partial G}{\partial T}T$$
(2.8)

いま温度 T, 圧力 Pを一定としているので右辺の第2, 第3項は消え

$$G(N, P, T) = \mu(T, P) \cdot N \tag{2.9}$$

となるので,<u>化学ポテンシャルは1分子当たりの自由エネルギー</u>であることがわかります。化学ポテンシャルは圧力 *P* と温度 *T* の 2 つを独立変数とする熱力学関数なので,そのグラフは図 2 に示すような曲面になります。

D. 相図(状態図)

物質がある圧力と温度の条件のもとで,気相,液相,固相のどの状態にあるかを示した図を相図(状態図)といい,物質がある相から他の相に変わることを(1次の)相転移といいました。図3に示されている各曲線は各相が平衡状態で共存する共存曲線を表します。

図 3の右図をご覧ください。一定の圧力 P の下で結晶をゆっくり加熱すると結晶の温度が次第に上昇し,さらに加熱を続けると温度が変わらなくなる状態が暫く続きます。この温度を融点 T<sub>m</sub> といいま

 $\mu = \mu(T, P)$ 

► P

図 2: 化学ポテンシャル



図 3: 相図と固液相転移

す。融点  $T_m$  では <u>固相と液相が共存</u> し, この状態においては,外から加えた熱は結晶を溶解するのに 使われるだけで系の温度上昇という形で外には現れないので「潜熱」と呼ばれます。結晶がすべて溶け てから液相の温度が再び上昇しはじめます。結晶の溶け始めから溶け終わりまでに加えた熱量  $\Delta Q$  は, 第2法則より  $\Delta Q = T_m \Delta S$  (可逆過程)で与えられるので,全分子数を N とすると1 個あたりの熱量 (潜熱)は

$$\frac{\Delta Q}{N} = T_m \frac{S_L - S_C}{N} = T_m \frac{\Delta S}{N} = T_m \Delta s \tag{2.10}$$

で与えられます。 $\Delta s$  は液相・固相間での分子1個あたりのエントロピーの差です。第1法則

$$dQ = dE + PdV \tag{2.11}$$

を使えば (2.10) は

$$\frac{\Delta Q}{N} = \frac{\Delta E + P\Delta V}{N} = \frac{H_L - H_c}{N} = \frac{\Delta H}{N} = \Delta h, \quad \Delta h = T_m \Delta s \tag{2.12}$$

と表され,分子1個あたりのエンタルピーの差としても表せます。

## 2-2.結晶成長の駆動力は化学ポテンシャル

ここでは <u>融液からの結晶成長</u> を見ていきます。N 個の分子からなる系が結晶相と液相の 2 つの相 に分かれれて存在しているとします。各相にある分子の数をそれぞれ  $N_L, N_C$  個とし,分子の総量  $N = N_L + N_C = -$ 定とすると,2相が共存する平衡状態での系全体の自由エネルギーは

$$G(N, P, T) = G_C(N_C, P, T) + G_L(N_L, P, T) = \mu_C N_C + \mu_L N_L, \quad N = N_C + N_L$$
(2.13)

で表され,定温・定圧下での平衡状態ではGは極小値( $\delta G = 0$ )をとるので

$$\delta G = \left(\frac{\partial G_C}{\partial N_C}\right)_{P,T} \delta N_C + \left(\frac{\partial G_L}{\partial N_L}\right)_{P,T} \delta N_L = \mu_C \delta N_C + \mu_L \delta N_L = 0$$

$$\delta N = \delta N_C + \delta N_L = 0, \qquad \therefore \ \delta N_C = -\delta N_L$$
(2.14)

と表せます。なお、このときのTは2相が共存する融点 $T_m$ です。この2式から

$$\delta G = \delta N_C (\mu_C - \mu_L) = 0, \quad \therefore \ \mu_C = \mu_L \tag{2.15}$$

つまり,分子レベルで見れば,液相の分子が1個増加したときの自由エネルギー $G_L$ の変化高は $\mu_L = (\partial G_L / \partial N)_{P,T}$ ,結晶に分子1個が組み込まれたときの自由エネルギーの変化高は $\mu_c = (\partial G_c / \partial N)_{P,T}$ で,<u>両相の化学ポテンシャルが等しい</u>状態にあるわけです。相図の共存曲線は $\mu_L = \mu_C$ の曲線をTP平面に射影したものです(図 4)。



図 4: 相図の共存曲線

いま,仮に結晶化が進んで $\delta N$ 個の分子が液相から結晶に組み込まれたとすると各相の分子の個数は

$$\begin{cases} N_c \to N_c + \delta N \\ N_L \to N_L - \delta N \end{cases}$$
(2.16)

となります。したがって,系全体の自由エネルギーの変化分 $\delta G$ は

$$\delta G = (\mu_c - \mu_L) \delta N = -\Delta \mu \delta N \qquad (\Delta \mu = \mu_L - \mu_c)$$
(2.17)

となります。これから,化学ポテンシャルの差 Δμ で次のような状態変化が起こることになります。

$$\begin{cases} \Delta \mu > 0 \ (\mu_c < \mu_L) \rightarrow \delta G < 0 : 結晶が成長していく \\ \Delta \mu = 0 \ (\mu_c = \mu_L) \rightarrow \delta G = 0 : 2 相共存 \\ \Delta \mu < 0 \ (\mu_L < \mu_c) \rightarrow \delta G > 0 : 結晶が融解していく \end{cases}$$
(2.18)

つまり, 化学ポテンシャルの差  $\Delta \mu$  が <u>結晶化の駆動力</u> となるということです (系は  $\mu$  の小さい方向に 向かう )。

過冷却度の定義は

$$\Delta T = T_m(P) - T \tag{2.19}$$

でした。過冷却状態での両相の化学ポテンシャルの差を

$$\Delta \mu(T, P) = \mu_L(T, P) - \mu_c(T, P)$$
(2.20)

とおき, 融点  $T_m$  の近傍でテイラー展開してその 1 次の項をとると

$$\Delta \mu \doteq \left(\frac{\partial \mu}{\partial T}\right)_P (T - T_m) = \left[\left(\frac{\partial \mu_L}{\partial T}\right)_P - \left(\frac{\partial \mu_c}{\partial T}\right)_P\right] (T - T_m) \tag{2.21}$$

と表せます。P = -定の定圧下では $S = -(\partial G/\partial T)_P \rightarrow s = -(\partial \mu/\partial T)_P$ とおけるので, (2.21) は

$$\Delta \mu \doteq (s_L - s_c)(T_m - T) = \Delta s \Delta T = \frac{\Delta h}{T_m} \Delta T$$
(2.22)

となり,結晶化の駆動力  $\Delta \mu$  は過冷却度  $\Delta T$  と比例関係にあることがわかります。

以上のことから,液相が融点以下の温度  $T(<T_m)$  に過冷却されている場合, $\Delta T > 0$ , $\Delta \mu > 0$ なので液相の中の  $\delta N$  個の分子が結晶化すると系全体の自由エネルギーは  $\delta G = -\Delta \mu \delta N$  だけ下がるので結晶化が自発的に進行すると予想されます。

2-3.核の生成

化学ポテンシャルの観点(自由エネルギー低減)からすれば,過冷却状態から直ちに結晶が析出し, どんどん結晶が大きく成長すると予想されますが,現実には必ずしもそうとはいかず,いくら待っても 結晶が析出しないことを経験された方も多いと思います。これはなぜか。。。!?

結晶化が起きるには"結晶の芽"となるある程度以上(といってもナノオーダーですが)の大きさの「結晶核(臨界核)」が必要で,まず「核」が生成され,その周りに融液中の分子が次々と組み込まれ て次第に結晶が大きく成長していきます。それではその辺りのメカニズムを見ていきましょう。

A. 界面自由エネルギー

 $\delta N$  個の分子からなる小さな微結晶を作ると (2.17) により自由エネル ギーは  $\Delta \mu \delta N$  だけ減少します。しかし,同時に固相 / 液相の界面が生 まれることによる<u>表面積に比例した界面自由エネルギー</u>の上昇を伴い, これが結晶核生成を抑止するブレーキの作用をします。

具体的に見ていきましょう。体積  $a^3$ , 半径 R の球状の結晶核を考え, 結晶は球状に成長していくというシンプルなモデルで考えます。結晶核 に含まれる分子の数を N とします。



結晶核 
$$\begin{cases} 体積 V = 4\pi R^3/3 \\ 表面積 A = 4\pi R^2 \\ 分子の数 N = V/a^3 = 4\pi R^3/3a^3 \end{cases}$$
 (2.23)

半径 R の結晶核ができたことで界面が形成され,界面の変化分を dA,表面張力 (界面張力)<sup>4</sup>を  $\gamma$  とすると,界面自由エネルギーは  $\gamma dA$  だけ増加します。したがって,自由エネルギーの変化分は,N 個の分子が核に取り込まれたことによる低減分と界面自由ネルギーの増分を加え

$$\Delta G = -\frac{4\pi R^3}{3a^3}\Delta\mu + 4\pi R^2\gamma \tag{2.24}$$

となります。

エネルギー障壁 分子 1 個あたりの自由エネルギーの変化分を求めます。結晶核の半径が  $\delta R$  だけ大き くなったときの自由エネルギーの変化分は (2.24) より

$$\delta(\Delta G) = \left(-\frac{4\pi R^2 \Delta \mu}{a^3} + 8\pi R\gamma\right)\delta R \qquad (2.25)$$

また,分子数の変化分を $\delta N$ とすれば,(2.23)より

$$\delta N = \frac{4\pi R^2}{a^3} \delta R \tag{2.26}$$

したがって,1個当たりの自由エネルギーの変化は

$$\frac{\delta(\Delta G)}{\delta N} = -\left(\Delta \mu - \frac{2a^3\gamma}{R}\right) \tag{2.27}$$

となります。右辺第 2 項の界面張力の項により核成長の駆動 力が  $\Delta \mu$  から  $2a^3\gamma/R$  だけ下がるので駆動力の低下を招くと いう次第です。



図 5: 球状核生成モデル

図 5 に  $\Delta G \geq R \geq o$ 関係をグラフ(太字曲線)で示しました。核半径 R の増加に伴い  $\Delta G$  は増加 して  $R = r^*$  で極大値  $\Delta G^*$  をとり,それ以降は単調減少します。この  $r^*$  を臨界核半径と呼んでいます。 図 5 からわかるように,核が生成されるためにはエネルギー障壁  $\Delta G^*$  を乗り越える必要があります。  $\Delta G^*$  は核生成の活性化エネルギーと呼ばれます。

 $^{4}\gamma = (\partial G/\partial A)_{T,P}$ ,  $\gamma = (\partial F/\partial A)_{T,V}$ 。次元は [表面張力] = [力]/[長さ] = [力][長さ]/[長さ][長さ] = [エネルギー][面積]

さて,臨界核半径 $r^*$ は $\Delta G$ が極大値をとる条件から求められ,

$$r^* = \frac{d(\Delta G)}{dR} = 0, \quad \therefore r^* = \frac{2a^3\gamma}{\Delta\mu} = \frac{2a^3\gamma T_m}{\Delta h} \frac{1}{\Delta T}$$
(2.28)

また,  $\Delta G^*$ は $R \rightarrow r^*$ として (2.24) と (2.22) より

$$\Delta G^* = \frac{16\pi}{3} \frac{a^6 \gamma^3}{(\Delta \mu)^2} = \frac{16\pi a^6 \gamma^3 T_m^2}{3\Delta h^2} \frac{1}{(\Delta T)^2}$$
(2.29)

この 2 式より過冷度度  $\Delta T$  が大きいほど臨界半径  $r^*$  並びに活性化エネルギー  $\Delta G^*$  が小さくなり , 核」の生成が容易になることが分かります。

R < r\*の極微小な分子の集合体(クラスター)はエンブリオ(embryo:胚種/幼核)と呼ばれ,環境相の中で生成・消滅を繰り返す安定した存在ではありません。R = r\*のクラスターを臨界核と呼んでいます。臨界核が生成されて初めて結晶成長が始まることになります。</p>

$$\left\{egin{array}{l} R < r^* & : エンブリオの生成・消滅 \ R = r * : 臨界核生成 \ R > r^* & : 核生成 & 結晶成長 \end{array}
ight.$$

熱揺らぎと核の生成 ところで,熱力学第2法則によれば「自然現象は自由エネルギー増加方向への 変化は禁止」という鉄則がありますね。これに従えば $\Delta G^*$ のエネルギー障壁を乗り越えることは禁止 で臨界核が生成されるハズはありません。しかし,熱力学の法則はマクロな法則でミクロな世界にま では厳密に適用されないという抜け道(?)があります。微視的状態では熱揺らぎにより熱平衡状態を 中心としたバラツキが生じていて,熱揺らぎにより自由エネルギーが $\Delta G^*$ だけ高い状態も実現するこ とがわかっています。統計力学<sup>5</sup>によれば,その実現確率は $\exp(-\Delta G^*/k_BT)$ に比例します。臨界核は 熱揺らぎを引き金として生成するわけです。

環境相の中に生成される臨界核の密度(単位体積中の数)を  $q_c^*$ ,環境相の中でクラスターを作らず に単独で存在する分子の密度を  $q_l$  とすると,  $q_c^*$  は

$$q_c^* = q_l \exp(-\Delta G^*/k_B T) \tag{2.30}$$

と表されます。臨界核に分子が1個組み込まれる頻度を $\nu_+$ とすると,臨界核より大きな安定核が生成 される核生成頻度をJとすると,Jは $q_c^*$ と $\nu_+$ の積となるので

$$J = \nu_{+}q_{c}^{*}\exp(-\Delta G^{*}/k_{B}T) = J_{0}\exp\left(-\frac{16\pi}{3}\frac{a^{6}\gamma^{3}}{(\Delta\mu)^{2}k_{B}T}\right) (\texttt{I}/\text{cm}^{3}\cdot\text{s}), \quad J_{0} = \nu_{+}q_{c}^{*}$$
(2.31)

J<sub>0</sub> は核成長の頻度因子と呼ばれます。

(2.29) より  $\Delta G^*$  は  $1/(\Delta T)^2$  または  $1/(\Delta \mu)^2$  に比例するので,過冷却度  $\Delta T$  または化学ポテンシャ ル  $\Delta \mu$  が小さいときには障壁が高く熱揺らぎによる臨界核の生成は困難ですが, $\Delta T$  または  $\Delta \mu$  を十分 大きくすると障壁が低くなって核生成が促進されやすくなることは既に述べたとおりです。

B. ウィルソン・フレンケルの式

過冷却融液からの結晶の成長速度を見ていきます。融液相から固・液界面に飛び込んだ分子は直ち に結晶相に組み込まれるというモデルを考えます。これは最大の成長速度 V<sub>max</sub> を考えることになりま す。成長速度は化学ポテンシャル Δμ, 過冷却度 ΔT に比例するとして

$$V_{max} = K \frac{\Delta \mu}{k_B T} = K_T \frac{\Delta T}{T_m} = K_T \left( 1 - \frac{T}{T_m} \right), \quad K_T = K \Delta h / k_B T$$
(2.32)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>ランダウ・リフシッツ「統計物理学(下)」岩波書店, 1977年

とおいたものをウィルソン・フレンケルの式と呼んでいます。

ウィルソン・フレンケルの式は結晶化の駆動力 Δµ が小さいときに成り立つ近似式です。融液中の分子は結晶ほどタイトに束縛されていなく,熱揺らぎにより平均位置の周りにほぼ結晶の格子振動数 ν 程度のオーダーで周りの分子と小突き合いしながら動きまわっていると考えられます。

いま,分子間距離 a を超えた移動(拡散)のための活性化エネル ギーを  $E_d$  とすると,熱揺らぎによって  $E_d$ の障壁を超えて動いた分 子がたまたま結晶の規則的配置に納まれば結晶化が進行したことに なります。液相と結晶相の分子1個当たりのエントロピーの差を  $\Delta s$ とすれば,結晶化が起きる速さは  $\nu e^{-E_d/k_BT} \cdot e^{-\Delta s/k_B}$ で,また逆に 結晶相の分子が  $\Delta \mu$  の障壁を超えて液相に変わることもあるので,差 し引き正味の成長速度 V は



$$V = a\nu e^{-E_d/k_B T} e^{-\Delta s/k_B} (1 - e^{-\Delta \mu/k_B T})$$
(2.33)

で与えられます。ここで  $\Delta \mu \ll 1$  とすると  $1 - e^{-\Delta \mu/k_BT} \doteq \Delta \mu/k_BT$  となり,これを上式に入れると (2.32) のウィルソン・フレンケルの式が得られます。この式の係数 K はカイネティック係数 (結晶の成 長係数)と呼ばれ,拡散定数と液体の粘性係数  $\eta$  を結びつけるストークス・アインシュタインの関係式 から

$$K = \frac{k_B T}{\pi a^2 \eta} e^{-\Delta s/k_B} \tag{2.34}$$

と表され,速度の次元を持ちます。

(2.33)の成長速度の温度依存性を図示したのが図 6 で,融点 T<sub>m</sub> 近くでは温度を下げると成長速度 は増しますが,温度を下げすぎると融液の粘性が増して分子が動きにくくなり成長が止まります。

さて,定温下での球状結晶の成長速度を求めます。成長速度をdR/dtとすると,(2.32)の $\Delta\mu$ に(2.27)の分子1個あたりの化学ポテンシャルの変化分  $|\delta(\Delta G)/\delta N|$ を入れると

$$V_{max} = \frac{dR}{dt} = \frac{K}{k_B T} \left( \Delta \mu - \frac{2a^3 \gamma}{R} \right) = V_0 \left( 1 - \frac{r^*}{R} \right), \quad V_0 = K \Delta \mu / k_B T$$
(2.35)

となります。成長速度を R の関数としてプロットしたのが図 7 で,  $V_0$ は  $R \rightarrow \infty$  での成長速度,つまり平面上の界面をもつ結晶の成長速 度です。図 7 から,  $R < r^*$  では核は生まれてもすぐ消えて成長せず,





臨界核半径より十分大きな  $R\gg r^*$ の結晶核ができれば,一定の速度  $dR/dt=V_0=K\Delta\mu/k_BT$ で大きくなることがわかります。

補足 - - -

・過冷却融液の中での核生成の実験:過冷却度 *ΔT* を大きくすれば核が急激に生成されるか?

< **タンマン<sup>6</sup>の実験(1903年)**>(出典:文献1)

(1) 融点  $T_m = 130^{\circ}$ Cのピペリン融液を作る。ちなみにピペリン( $C_{17}H_{19}O_3N$ )は胡椒の辛味成分。

(2) 融液を $T_m$ より十分低い温度 $T(100^{\circ}C$ 以下)の熱浴に10分間浸け,その間に核を生成させる。

(3) (2) で生成された核を観測可能な大きさにまで成長させるために,  $100^{\circ}C$ の熱浴に4分間放置した

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Gustav Heinrich Johann Apollon Tammann: 1861-1938。ドイツの著名な化学者・物理学者。ガラス質および固溶、不均一平衡、結晶化、冶金学の分野で重要な貢献をした。(Wiki)

後,核の数を数える。100°Cの温度では,新たな核生成は起こらずに安定核の成長だけが起きている。

図 8 はその実験結果で,核生成頻度が核生成の温度 T にどのように依存するかを示しています。温度 T が 80°C 以下(過冷却度  $\Delta T = T_m - T \ge 50$ °C)になると核生成頻度 J は急激に立ち上がっ ていますが, T が 40°C 以下( $\Delta T \ge 90$ °C)と過冷却状態をさらに 進めると今度は逆に J が下がりはじめています。これは融液の粘 性が急激に大きくなり,その結果分子が動きにくなり,臨界核にさ らに分子が組み込まれて安定核となる頻度  $\nu_+$  が急激に減少するた め J が下がりはじめるということですね。(水を過冷却するとドロ ドロの高粘性水になる!)



核生成の Dynamics

# § 3.

核生成のダイナミクスを見ていきます。結晶の核生成の現象は本質的に過飽和水蒸気中の小さな液滴の生成問題と同じとされる<sup>7</sup>ので,最も簡単な場合として気相が過飽和になったときにどのようなことが起こるかを見ていくことにします。

# 3-1.液滴の生成(3次元核生成)

過飽和水蒸気というのはいうまでもなくバルクの水の飽和水蒸気圧  $P_{eq}$  以上の蒸気圧を示す水蒸気の ことで,飽和水蒸気以上の多くの水分子を含んでいます。したがって,この中から生まれる液滴は気体 の水分子が衝突して凝縮,あるいは液滴から水分子が離脱するということを高頻度で繰り返しながら 次第に大きな液滴となっていくことが予想されます。しかし,注意深い実験によれば,清浄・純粋な水 蒸気だけを含む空気では飽和水蒸気圧の3~5倍の過飽和状態でも水滴が形成されないことが観測<sup>8</sup>され ています。この実験結果は液滴が生成されても即座に蒸発し大きく成長しないことを示しています。液 滴は微小とはいえ液相ですから液滴の平衡蒸気圧が存在しますね。いま,バルクの水の過飽和蒸気圧 を $P_{eq}$ とし,半径rの液滴の平衡蒸気圧をP(r)とすると,液滴が即座に蒸発することを意味します。



図 9: ケルビン効果

 $P_{eq} < P(r)$ である理由は次のように考えれば納得できます。微小な液滴の表面付近の分子は曲面状に並ぶのでバルク表面の分子数より少なく周辺からの分子間引力は弱くなります。このため引力を振

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>文献 1 参照。

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>ウィルソンの霧箱で有名な Charles Thomson Rees Wilson (1869-1959,英国の物理学者。1927年 Nobel 賞受賞)は, 清浄・純粋な水蒸気だけを含む空気では飽和水蒸気圧の3~5倍の過飽和状態が実現されることを観測している。

り切って蒸発しやすく,その結果  $P(r) > P_{eq}$ になるというわけですね。これを曲率効果とかケルビン 効果と呼んでいます $^9$ 。

さて,液滴はどのように生成されるのか,このダイナミクスを気体分子運動論の観点から見ていく ことにします。気体(蒸気)は理想気体とします。

凝縮・離脱頻度 最初にバルク表面と液滴表面における分子の凝縮・離脱頻度を比べてみます。図 10 に示すように xy 平面をバルクの液体表面にとり,単位時間・単位面積あたりに液面に飛び込んでくる



図 10: 気体分子の凝縮と表面自由エネルギー

分子の数(フラックス)を  $J_{inp}$  ( 個/cm<sup>2</sup>・秒 ) とします。質量 m の気体分子の速度分布は (3.1) のマ クスウェル分布

$$f(\boldsymbol{v})d\boldsymbol{v} = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-mv^2/2k_B T} d\boldsymbol{v}$$
(3.1)

をしているので,nを気体の平均分子数密度とすれば,フラックス $J_{inp}$ は

$$J_{inp} = \int_{-\infty}^{\infty} dv_x \int_{-\infty}^{\infty} dv_y \int_{-\infty}^{0} dv_z n v_z \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} e^{-m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2)/2k_B T}$$
  
=  $n\sqrt{\frac{k_B T}{2\pi m}} = \frac{1}{4}n\overline{v}$  ( $\overline{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}}$ : 分子の平均速度) (3.2)

で与えられます。液面に飛び込んできた分子が界面でリバウンドすることなくただちに液体相に組み込まれるものとすると, *J<sub>inp</sub>* は単位面積あたりの凝縮頻度 を表します。蒸気(気相)は理想気体としているので,理想気体の状態方程式

$$PV_m = RT = N_A k_B T, \quad \therefore \quad P = \frac{N_A}{V_m} k_B T = n k_B T \tag{3.3}$$

に (3.2) を入れると

$$J_{inp} = \frac{P}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \tag{3.4}$$

が得られます。

蒸気圧 P がバルクの平衡蒸気圧  $P_{eq}$  であれば,液相・気相の平衡状態にあるので液面からの分子の離脱頻度は凝縮頻度  $J_{inp}$  に等しいはずです。したがって,液面からの水分子の離脱頻度を  $J_{out}(\infty)^{10}$ とすれば

$$J_{out}(\infty) = \frac{P_{eq}}{\sqrt{2\pi m k_B T}} = J_{inp}$$
(3.5)

が成立します。これは液相 (L) と気相 (V) の平衡条件である各相の化学ポテンシャルが相等しい $\mu^L(\infty) = \mu^V \tag{3.6}$ 

ということに対応しますね。

 $^{10}\infty$ の記号は無限平面の液面を表す意味で付けています。

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>半径 r の液滴の蒸気圧 P(r) は  $\ln \frac{P(r)}{P_{eq}} = \frac{2\gamma V_m}{rRT}$ で与えられ,これをケルビン(William Thomson)方程式とよんでいます。 $\gamma$ :表面張力, $V_m$ :モル体積。 $R = N_A \cdot k_B$ , $N_A$ :アボガドロ数。水の場合, $r = 1\mu$ mの液滴の蒸気圧は $P_{eq}$ の0.1%, $r = 0.1\mu$ mで1.1%, $r = 0.01\mu$ mで1.1%高くなります。(3.10)で導出します。

凝縮 次に,液滴に気体分子が衝突して組み込まれる(凝縮)場合を考えます。半径rの液滴は $4\pi r^2 \gamma$ の表面自由エネルギーを持っているので,dN個の気体分子が液滴に凝縮して半径がdr増加したときの表面自由エネルギーの増加分は $8\pi r \gamma dr$ です。分子1個の体積<sup>11</sup>を $v_L$ とすると,液滴中の分子の数は $(4/3)\pi r^3/v_L$ なので,dNとdrの関係式として

$$dN = d\left(\frac{4}{3}\pi r^3 \middle/ v_L\right) = (4\pi r^2 / v_L)dr, \quad \therefore \quad \frac{dr}{dN} = \frac{v_L}{4\pi r^2}$$

が得られ、これから気体分子1個が液滴に組み込まれるごとの液滴の表面自由ネルギーの増加分は

$$\Delta g = 8\pi r \gamma \frac{dr}{dN} = \frac{2v_L \gamma}{r} \tag{3.7}$$

となります。一方,表面が平坦なバルクでは,分子の凝縮・離脱に際して表面は単に平行移動するだけ (表面積は変わらない)なので表面エネルギーの変化はありません。

表面自由エネルギーが増えることは液滴にとっては不安定要因となるのでエネルギーを減らすべく 分子の離脱(蒸発)が進みます。

$$J_{out}(r) > J_{out}(\infty) = J_{inp} = \frac{P_{eq}}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

$$(3.8)$$

液滴からの水分子の離脱は平衡蒸気圧 P(r) に達するまで続き,平衡蒸気圧に達したときに凝縮・離脱 頻度が等しい平衡状態となります。

$$J_{out}(r) = J_{inp} = \frac{P(r)}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$

$$(3.9)$$

ギブス・トムソンの式 液滴の平衡蒸気圧 P(r) とバ ルクの平衡蒸気圧  $P_{eq}$  関係は

 $\ln \frac{P(r)}{P_{eq}} = \frac{2v_L\gamma}{k_BTr} \longleftrightarrow \frac{P(r)}{P_{eq}} = \exp\left(\frac{2v_L\gamma}{k_BTr}\right) (3.10)$ で与えられ、ギブス・トムソンの式と呼んでいます。

また, 左辺の  $P(r)/P_{eq}$  を過飽和比と呼んでいます。 ギブス・トムソンの式は半径 r の液滴の化学ポテン シャル  $\mu^L(r)$  と気相の化学ポテンシャル  $\mu^V$  が等しい という 2 相共存の平衡条件から導けます。 $\mu^L(r)$  はバ ルクの液体の化学ポテンシャル  $\mu^L(\infty)$  より液滴の表 面エネルギー分高いので, (3.7)より



ルクの水の平衡蒸気圧 P<sub>eq</sub> の比(文献.1)

$$\mu^L(r) - \mu^L(\infty) = \frac{2v_L\gamma}{r} \tag{3.11}$$

気・液平衡状態にあるとき各相の化学ポテンシャルは等しく,理想気体の化学ポテンシャル $\mu = k_B T \ln P$ を使えば (3.11) は

$$\mu^{L}(r) - \mu^{L}(\infty) = k_{B}T\ln P(r) - k_{B}T\ln P_{eq} = k_{B}T\ln\frac{P(r)}{P_{eq}} = \frac{2v_{L}\gamma}{r}$$
(3.12)

となり, ギブス・トムソンの式が得られます。

図 11 は  $T = 0^{\circ}$ C での過飽和比  $P(r)/P_{eq}$ と液滴半径 r の関係グラフで,液滴の半径 r が  $1\mu$ m(=  $1 \times 10^{-4}$ cm) で以下となると急激に P(r) が大きくなる様子がわかります。また, $1\mu$ m 以上の大きさの液滴の平衡蒸気圧はバルクの平衡蒸気圧  $P_{eq}$  に漸近することが分かります。

 $<sup>^{11}</sup>$ 水 1 mol の体積は約 18cm<sup>3</sup> なので,水分子 1 個の体積はアボガドロ数で割ると  $v_L \simeq 3 \times 10^{-23}$  cm<sup>3</sup>。

さて,実際の蒸気圧を $P=2P_{eq}$ としたときの液滴の半径を $r^*$ とすると, $r < r^*$ の液滴は,Pが液滴の平衡蒸気圧P(r)より低い(P < P(r))ため,離脱頻度が凝縮頻度を上回って液滴は蒸発する傾向が強まり,逆に $r > r^*$ の液滴ではP > P(r)となるので液滴は大きく成長します。 $r = r^*$ ではP = P(r)となり,両相は平衡状態となり,離脱頻度と凝縮頻度が等しく気相・液相の2相が共存します。 $r^*$ は蒸発と凝縮の端境となるサイズということで臨界半径,そのサイズの水滴を臨界核と呼んでいます。

 $\begin{cases} r < r^* \to P < P(r) : J_{out} > J_{inp} & 平衡蒸気圧 P(r) 達成に向け液滴蒸発 \\ r = r^* \to P = P(r) : J_{out} = J_{inp} & 液滴誕生 \\ r > r^* \to P > P(r) : J_{out} < J_{inp} & 蒸発せずに液滴成長 \end{cases}$ 

3-2. 臨界核半径

液滴の臨界核半径  $r^*$  を求めていきます。気体分子の一部が凝縮し,n 個の分子からなる半径 r の液 滴<sup>12</sup>が生成されたとします。このとき,系の自由エネルギーは  $n\Delta\mu$  だけ減少すると同時に  $4\pi r^2\gamma$  の<u>界</u> 面自由エネルギーの増加があるので,全体の自由エネルギーの変化は

$$\Delta G = -\frac{4\pi r^3}{3v_L} \Delta \mu + 4\pi r^2 \gamma \qquad (\Delta \mu = \mu^V - \mu^L)$$
(3.13)

となります。



図 12: 臨界半径 r\*

 $\Delta G$ は $r = r^*$ で最大値をとり, $\partial \Delta G / \partial r = 0$ となる $r = r^*$ は臨界核半径で,その時の $\Delta G^*$ が臨界核生成エネルギーで, $(\Delta G / r)_{r=r^*} = 0$ より $r^*$ と $\Delta G^*$ は次式で与えられます。

$$r^* = \frac{2v_L\gamma}{\Delta\mu}, \quad \Delta G^* = \frac{16\pi v_L^2\gamma^3}{3\Delta\mu^2}$$
(3.14)

この式に  $\Delta \mu = k_B T \ln P(r) / P_{eq}$  を入れると<sup>13</sup>  $r^* = \frac{2\gamma v_L}{k_B T \ln(P/P_{eq})} = \frac{2M}{\rho RT} \cdot \frac{\gamma}{\delta}, \quad \delta \equiv \ln(P/P_{eq})$  $\Delta G^* = \frac{16\pi M^2}{3\rho^2 R^2 T^2} \cdot \frac{\gamma^3}{\delta^2}$ (3.15)

(M:分子量,ρ:液の密度,R:気体定数)

核生成の駆動力  $\Delta \mu$  が大きい(過飽和比が大きい)ほど臨 界半径  $r^*$  は小さくなり(図 13),また, $\Delta G^*$  も低くなるの で液滴が成長しやすくなりますね。



図 13: 過飽和比と臨界核半径

$$\frac{v_{\scriptscriptstyle L}}{k_{\scriptscriptstyle B}} = \frac{v_{\scriptscriptstyle L}}{(R/N_A)} = \frac{M}{(M/N_A \cdot v_{\scriptscriptstyle L})R} = \frac{M}{\rho R}$$

 $<sup>^{12}</sup>r = 1\mu m (10^{-4} cm)$ の水滴には約 $10^{11}$ 個の水分子が詰まっている。

 $<sup>^{13}</sup>M:1 \,\mathrm{mol}$ の質量 ,  $N_A v_L:1 \,\mathrm{mol}$ の体積 ,  $ho=M/N_A v_L:$ 密度 ,  $N_A:$ アボガドロ数 とすると

3-3.ヘルツ・クヌーセンの式

気相からの結晶の成長速度を求めていきましょう。気相から結晶表面に飛び込んだ分子は直ちに結晶 相に組み込まれるとします。結晶相の分子数を N<sub>c</sub> とすれば,その時間変化は凝縮頻度と離脱頻度の差 で与えられるので

$$\frac{dN_c}{dt} = J_{inp} - J_{out}(\infty) = \frac{P - P_{eq}}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$$
(3.16)

となります。1分子の占める面積を  $f_0$ とすると,単位面積当たりに $1/f_0$ 個の結晶層分子の増加があれ



ば,その結晶表面は厚みを b とする 1 分子層で覆われることになります。従って,最大の成長速度,結 晶相の厚みの増し高は

$$R_{max} = bf_0 \frac{dN_c}{dt} = \frac{v_c(P - P_{eq})}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \qquad (v_c: 結晶の 1 分子の体積)$$
(3.17)

で与えられます。この式をヘルツ・クヌーセンの式と呼んでいます。ちなみに $-15^{\circ}$ Сの過飽和比14%で成長する氷の結晶の場合の $dN_c/dt$ と最高成長速度 $R_{max}$ を求めると, $v_c = 3 \times 10^{-23} \text{cm}^3$ , $P_{eq} = 1.92 \times 10^3 \text{dyn/cm}^2$ , $P/P_{eq} = 0.14$ , $k_B = 1.38 \times 10^{-16} \text{erg/K}$ , $m = 3 \times 10^{-23}$ gとして(3.16),(3.17)より

$$\begin{cases} \frac{dN_c}{dt} = 1.0 \times 10^{20} \,\text{@/cm}^2 \cdot \text{s} \\ R_{max} = 3.0 \times 10^{-3} \text{cm/s} = 30 \mu \text{m/s} (1 秒間に 0.03 \text{mm}) \end{cases}$$
(3.18)

と得られます。

(3.17)は結晶表面に飛び込んだ分子は<u>真ちに結晶相に組み込まれる</u>と仮定して導かれたものでした。 これはレアケースで,普通は結晶表面での分子の複雑な挙動の結果として結晶相に組み込まれるので 成長速度は  $R_{max}$  以下となりこれを超えることはありません。 $dN_c/dt$ の内の  $\alpha$ % が結晶相に組み込ま れるとした場合の一般的な成長速度 R は,

$$R = \alpha b f_0 \frac{dN_c}{dt} = \alpha \frac{v_c (P - P_{eq})}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \le R_{max} \quad (0 \le \alpha \le 1)$$
(3.19)

と表され, $\alpha$ を凝縮係数と呼んでいます。

 $R_{max}$ と結晶成長の駆動力  $\Delta \mu$ の関係を見ておきます。気相と結晶相の化学ポテンシャルの差は (3.12)より

$$\Delta \mu = k_B T \ln \frac{P}{P_{eq}}, \quad \therefore P - P_{eq} = \left[1 - \exp\left(-\frac{\Delta \mu}{k_B T}\right)\right] P \tag{3.20}$$

これを (3.17) に入れると

$$R_{max} = \frac{v_c P}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \left[ 1 - \exp\left(-\frac{\Delta\mu}{k_B T}\right) \right] \longrightarrow \frac{v_c P}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \frac{\Delta\mu}{k_B T} \quad (\Delta\mu \ll 1)$$
(3.21)

となります。 $\Delta \mu$  の小さいところでは  $e^{-\Delta \mu/k_BT} \doteq 1 - \Delta \mu/k_BT$  と近似できるので  $\underline{R_{max}}$  は  $\Delta \mu$  に比例 することを示しています。

15

結晶核が生成されると,環境相から核の表面上に吸着した分子は結晶格子を形成するように次々と 配列し,次第に結晶は大きく成長していきます。このあたりのダイナミクスを見ていきます。

§3-3で $-15^{\circ}$ C,過飽和比14%の環境下で成長する氷の結晶 の最大成長速度を $R_{max} = 30 \mu m/s$ と見積もりました。この環境 下での雪の結晶は図15に示すような薄い六角柱になることが 知られています。決して<u>ピンポンボールのような球形結晶ではあ</u> りません。平らな面をベーサル面(basal face),柱面をプリズ ム面(prism face)と呼んでいますが,このような形になるのは



結晶格子の面方位によって成長速度が異なるためで,プリズム面の成長速度がベーサル面の成長速度よ リ早いために生じています(本節末参照)。文献1によればR(1010)=0.5µm/s,R(0001)=0.05µm/s とのことです。結晶の成長速度は下地となる面の方位異方性を反映しているわけですね。分子レベルで 見れば,ベーサル面は平坦な表面であるのに対してプリズム面は荒れた表面となっています。荒れたと いう意味は結合手が多くでているということです。ツルツルの平滑な面は滑りやすく,荒れた面は引っ かかりやすい。気相からベーサル面に飛び込んできた分子は表面上をうろつき回ってなかなか結晶相 に組み込まれませんが,プリズム面に飛び込んだ分子はあまりうろつきまわることなく結晶相に組み 込まれるので成長が早い,というイメージで捉えることができます。

4-1.2次元核の成長(沿面成長)

A. コッセル機構

気相から結晶表面に入射した分子は運動エネルギーの 大部分を熱として失う(非弾性衝突)ので,結晶表面の 分子との結合力を振り切って気相に戻ることができず,し ばらく結晶表面にとどまり安定な位置を求めてウロウロ 動き回ります(拡散)。この表面に滞在する分子を吸着分 子とか付着分子と呼んでいます。



結晶の表面は図 16 に示すように, 平滑なテラス (ter-

race),高さの異なるテラス間の階段であるステップ(step:結晶表面上に存在する分子層の段差),ス テップの折れ曲がったところのキンク(kink)と呼ばれる形状を有しています<sup>14</sup>。テラスに吸着した分 子は図 19に示すように表面分子との結合の回復により吸着エネルギー *E<sub>a</sub>* だけポテンシャルエンネル ギーの低い状態となりますが,さらに安定なところを求めてテラス上を動き回り,ステップに当たると 次にステップに沿って動き,結合手が最も多いキンクに当たって安定化し,そこで結晶格子に組み込ま れます。もっともテラスに吸着したすべての分子がキンクで結晶格子に組み込まれるわけではなく,動 き回っている途上で熱揺らぎによって吸着エネルギー以上のエネルギーを獲得すれば表面から離脱し 気相へと蒸発していきます。

このあたりの状況を少し定量的に見ていきましょう。バラバラに存在した N 個 の原子が凝集してバ ルクの結晶を形成すると,原子間結合エネルギー分だけ系のエネルギーは低下しますね。いま,簡単化

14これ以外に吸着原子が集まった「島」とかテラス上の原子が抜けた「穴(空孔)」とかいろいろな構造があります。

して結合は n 個の最隣接原子間だけで生じるとし,1本あたりの結合エネルギーを J とします。エネル ギーの低下分を ΔE とすると,原子1個あたりに換算値を Δh とすると,1本の結合は2個の原子で共 有されていることを考慮すれば

$$\Delta h = \frac{\Delta E}{N} = \frac{1}{2}nJ \tag{4.1}$$

となり,原子が1個結晶相に組み込まれると nJ/2 だけエネルギーが低下します。具体的に図 17の単



図 17: 単純立方格子

純立方格子結晶の場合でどうなるかというと,中央の大きな黒丸に注目すれば最隣接原子の数は上下 左右の白丸の数で n=6,従って  $\Delta h$  は

$$\Delta h = \frac{1}{2}(6 \times J) = 3J \tag{4.2}$$

となります。

テラスに吸着した原子は,結合手は1本でJの安定化,ステップに達すると結合手は2本で2Jの安 定化,キンク位置で結合手が3本で3Jの安定化。つまり,キンク位置で結晶相に組み込まれたと見做 せます。原子がキンクに1個組み込まれるごとにキンクは前進しステップの前進も起こり,しばらくし てテラスは1原子層で覆い尽くされます。その後,原子が新たなテラスに付着して結晶の成長が起こ る。このようなことの繰り返しで結晶の厚みが増し成長していく,というのがドイツの物理学者Kossel が結晶成長の動力学理論として提唱(1928,1930)したコッセル機構<sup>15</sup>です。このような成長様式を沿面 成長とか層成長と呼んでいます。

成長速度が面方位によって異なる理由 図 18 に示すように単純立方格子結晶を例えば3つの方位面か ら原子レベルでその表面の様子を観察すると,(001)面はステップもキンクもない原子結合が稠密な平 らな面(特異面と呼ばれる)で,(110)面はキンクなしのステップだけの面(断崖絶壁のような面), (111)面はキンクばかりの面(岩がゴツゴツしているような面)となります。気相からキンクだらけの (111)面に飛び込んだ原子は直ちに結晶相に組み込まれることになります。このように,面方位によっ て結晶成長速度が異なる理由はここにあるわけです。





<sup>&</sup>lt;sup>15</sup>Walther Ludwig Julius Kossel (1888-1956):ドイツの物理学者。Kossel 機構は結晶構造に何の乱れもない理想的に完全 な結晶であることを前提に考えられていて,原子をサイコロや角砂糖のような形に捉えて結晶成長プロセスを考えています。

コッセル機構では表面欠陥のない理想的な完全結晶が前提となっていて,結晶成長のシナリオは,吸 着分子 表面拡散 キンクで結晶相 キンクの前進 ステップの前進 新たなテラスの形成(成長)と いうものでした。ところで,ステップもキンクもない平らな新たなテラスからは結晶成長が起こらない のでは!?という疑問が起こりますね。実は,テラス状を動き回る原子がたまたま別の吸着原子とぶつ かり結合を作ればエネルギーが下がって合体し,2次元の島状の結晶核を作ります。この島状の縁には ステップがあり,そこにはキンクがあるので島が大きくなって結晶成長がはじまるというわけです(尤 も,成長するための条件はありますが)。このような成長の仕方を2次元核成長といいます。ここでは 吸着分子を取り巻く表面でのエネルギー環境を見てみます。

平均滞在時間 テラスに吸着した原子は吸着エネルギー *E*a 分だけ安定化しています。結晶表面のエネ

ルギー環境は,結晶格子の周期性(格子間隔a)を反映し, ある安定位置と隣の安定位置の間には E<sub>sd</sub> だけエネルギー の高い状態が繰り返され,波板のような状態になってい ます。吸着分子はこの波板を乗り越えつつ安定な位置を求 めて酔歩・拡散していくのですが,その途中で熱揺らぎに よって吸着エネルギー E<sub>a</sub> 以上のエネルギーを獲得すれば 表面から蒸気相へと離脱していきます。吸着から離脱まで の時間平均が <u>平均滞在時間</u>で,これは離脱確率の逆数で 与えられます。



表面に吸着した原子は結晶の格子振動数  $\nu$  程度の速さで揺れており,1回の振動で吸着エネルギーの 障壁  $E_a$ を乗り越える確率は  $\exp(-E_a/k_BT)$ と見積もれるので,単位時間に表面から離脱する確率は  $w = \nu \exp(-E_a/k_BT)$ と算定されます<sup>16</sup>。これから平均滞在時間  $\tau$  を求めると

$$\tau = 1/w = \nu^{-1} \exp(E_a/k_B T) \tag{4.3}$$

となります。吸着エネルギー  $E_a$  が大きい程,また温度 T が低いほど滞在時間は長くなるので,吸着原子が結晶相に組み込まれる率は高くなります。ちなみに雪の結晶の場合, $E_a = 4.25 \times 10^{-13}$ erg, $\nu = 1 \times 10^{13}$ /s,T = 258K( $-15^{\circ}$ C)とすると $\tau = 1.5 \times 10^{-8}$ 秒となります。

表面拡散距離 吸着分子が平均滞在時間  $\tau$  の間に表面拡散によって動き回る拡散距離を  $x_s$  とすると, 表面拡散距離の2乗は平均滞在時間  $\tau$  に比例する(2次元ブラウン運動・アインシュタインの公式)ので

$$x_s^2 = D_s \tau \tag{4.4}$$

とおけます。比例係数 D<sub>s</sub> を表面拡散係数と呼んでいます。拡散は格子間隔 a で周期的にあるエネル ギーの凹凸 E<sub>sd</sub> を乗り越えて進むので,拡散係数は

$$D_s = a^2 \nu \exp\left(-\frac{E_{sd}}{k_B T}\right) \tag{4.5}$$

で与えられ, $E_{sd}$ は表面拡散の活性化エネルギーと呼ばれます。(4.3),(4.5)を(4.4)に入れて拡散距離 $x_s$ を求めると

$$x_s = a \exp\left(\frac{E_a - E_{sd}}{2k_B T}\right) \tag{4.6}$$

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> 厳密には *v* は原子の吸着面に垂直な方向の振動数。

となります。温度が低い場合の気相成長の場合では, $x_s$  は格子間隔aの数百倍程度( $x_s \simeq 10^2 a$ )と見 積もられていますが,結構動き回りますね!。この間に結晶相への組み込みが起こらなければ吸着原子 は再び気相へと離脱していきます。

#### 氷のベーサル面は成長が遅い理由

氷の結晶のベーサル面はステップもキンクもない平坦な面(特 異面)なので,入射分子は結晶相に組み込まれる機会が少なく, 平均滞在時間後には蒸発していきます。単位面積当たり毎秒 $J_{inp}$ 個の分子が飛び込んでくるので吸着分子密度nは増加しますが, 同時に毎秒 $nw = n/\tau$  個の分子が離脱しています。吸着分子密度 nが小さい間は入射フラックス $J_{inp}$ は離脱フラックス $n/\tau$ より 大きいので,正味の吸着分子数密度nは時間とともに増加しま す。と同時に,nが増えると離脱フラックス $n/\tau$ も増加するの



図 20: 吸着分子密度の時間変化

で,過飽和状態にもかかわらずしばらくすると入射・離脱のフラックスがバランスし,吸着分子密度 n は一定値に飽和していきます。バランス状態での飽和吸着分子数密度を n<sub>sat</sub> とすると,入射・離脱の フラックスが等しいので

$$J_{inp} = n_{sat}/\tau \tag{4.7}$$

これに (3.4) を入れて n<sub>sat</sub> を求めると

$$n_{sat} = \tau J_{inp} = \frac{\tau P}{\sqrt{2\pi m k_B T}} \tag{4.8}$$

となり,  $n_{sat}$  は蒸気圧 P に比例して大きくなります。いま, t=0 で表面の吸着分子密度をn(0)=0, 時刻 t での正味の吸着分子密度をn(t) とすると, n(t) の時間変化は次の微分方程式

$$\frac{dn(t)}{dt} = J_{inp} - \frac{n(t)}{\tau}$$

で表され,これから

$$n(t) = \tau J_{inp}(1 - e^{-t/\tau}) \tag{4.9}$$

と求められ, n(t) の時間変化を図 20 に示します。

ベーサル面では,入射分子は表面に吸着し飽和密度  $n_{sat}$  にまで達しますが,そこで吸着・離脱のバランスがとれてしまうので結晶相に組み込まれる分子は0,つまり凝縮係数は  $\alpha \simeq 0$  となります。ちなみに水飽和条件  $P = P_W$  での  $n_{sat}$  は (4.8) より

$$n_{say} = \frac{\tau P}{\sqrt{2\pi m k_B T}} = \frac{1 \times 10^{-8} \times 1.92 \times 10^3}{\sqrt{2\pi \times 3 \times 10^{-23} \times 1.38 \times 10^{-16} \times 258}} = 7.4 \times 10^{12} \,\text{(B/cm}^2 \tag{4.10}$$

となり、これは (001) 面の格子密度  $5.65 \times 10^{14}$  個/cm<sup>2</sup> の 1/100 にあたり、格子 100 個に 1 個の割合で 吸着分子が存在していることになります。

- 1. 黒田登志雄「結晶は生きている」サイエンス社,昭和59年
- 2. 斎藤幸夫「結晶成長」裳華房, 2002年
- 3. 山本大二郎,岡田功「化学熱力学演習」産業図書,昭和41年